

## Анализ поверхности поликристалла CVD алмаза до и после термохимической шлифовки

*Лебеденко А.В.*<sup>1,2</sup>, *Клепиков И.В.*<sup>1,2,3</sup>, *Куликов Е.Н.*<sup>4</sup>, *Дерябкин А.В.*<sup>4</sup>, *Фёдоров Ю.Ю.*<sup>4</sup>, *Шепелев В.А.*<sup>2</sup>

st068736@student.spbu.ru

<sup>1</sup> СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

<sup>2</sup> РТУ МИРЭА, Москва, Россия

<sup>3</sup> ООО «НПК «Алмаз», Санкт-Петербург, Россия

<sup>4</sup> АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Поликристаллический алмаз (PCD) представляет собой материал с уникальным сочетанием размера, физических свойств и стоимости. Он находит применение в полупроводниковых структурах, оптических компонентах, теплоотводящих и износостойких покрытиях [1]. Необходимость полировки CVD PCD становится важным этапом его подготовки к использованию в качестве теплоотводов, т.к. он трудно поддается механической полировке. Термохимическая шлифовка (ТХШ) – один из перспективных методов обработки поликристалла CVD алмаза. В работе методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) проанализирована морфология поверхности двух образцов CVD PCD размером ~5x5 мм, до и после ТХШ в статическом режиме.

Морфология выращенного CVD PCD до ТХШ представлена сложным агрегатом, состоящим из кристаллитов октаэдрического габитуса высотой до 6 мкм (рис. 1, а). Видно пластинчато-ступенчатое строение октаэдрических граней в кристаллитах. Шероховатость поверхности  $R_a$  такого образца на участке 100x100 мкм составляет ~ 2 мкм, на некоторых участках доходит до 20 мкм. Аналогичный образец CVD PCD был обработан методом термохимической шлифовки в статическом режиме в водородной печи при температуре около 1100°C на пластине никеля 9 класса чистоты. Он характеризуется макроскопически гладкой поверхностью, со слабовыраженной штриховкой. Поверхность состоит из сглаженных округлых бугорков (высотой не более 2 мкм), отличимо микропористое строение. Шероховатость поверхности  $R_a$  составляет порядка 500 нм, с воспроизводимостью на разных участках.

Таким образом, статическая ТХШ является быстрым и эффективным методом снижения шероховатости поверхности CVD PCD. Необходимо дальнейшее совершенствование технологии ТХ обработки крупных CVD PCD ( $d \geq 100$  мм) для снижения уровня шероховатости поверхности. Исследования АСМ были выполнены в РЦ «Микроскопии и микроанализа» СПбГУ. Результаты получены в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FSFZ-2022-0006).

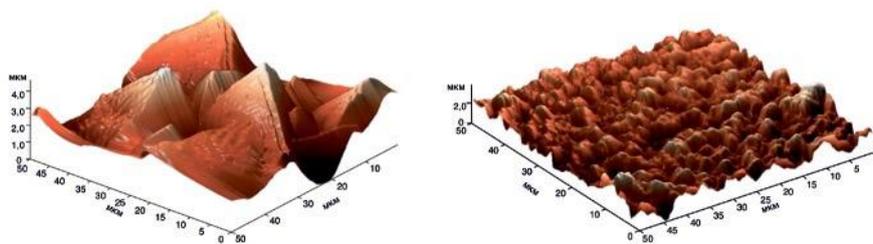


Рис.1. 3D АСМ-изображения CVD PCD а) до и б) после ТХШ.

### Ссылки

1. Р.А. Хмельницкий, Н.Х. Талипов, Г.В. Чучева, Синтетический алмаз для электроники и оптики (Издательство ИКАР, Москва, 2017), 2.